

11  
©1995

## НЕРАВНОВЕСНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ИОНИЗАЦИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

*Н.М.Блащенко, Г.Я.Лаврентьев*

Модель неравновесной поверхностной ионизации [1], основывающаяся на существовании неравновесных колебательных состояний адсорбированных молекул, приводит к значительному увеличению тока десорбируемых возбужденных ионов.

В приводимом в [1] эксперименте возбуждение колебательных состояний молекул и радикалов достигалось за счет энергии гетерогенной экзотермической химической реакции разложения перекиси ацетона. Это весьма мощный источник возбуждения. При использовании обычных широкозонных источников накачки (лампы накаливания, разрядные лампы и т. д.) процессы релаксации колебательных возбуждений адсорбированных частиц могут оказаться преобладающими как из-за относительно малой мощности источников излучения, так и из-за большого времени жизни ионов молекул и радикалов на поверхности. Последняя причина может быть в значительной степени устранена при использовании в опытах умеренных электрических полей [2]. Это позволяет надеяться на проявление возбужденных состояний адсорбированных частиц в токе десорбируемых ионов. Однако влияние электрического поля на процесс ионизации возбужденных частиц может быть многосторонним, что делает желательным аналитическое рассмотрение задачи.

Выведем выражение для степени неравновесной поверхностной ионизации ( $\alpha_n$ ) для колебательно-возбужденных частиц в ускоряющем ионы электрическом поле ( $\mathcal{E}$ ). Будем следовать статистическому выводу  $\alpha_n$ , проведенному в [1], т.е. будем считать, что с эмиттера с температурой  $T$ , к которому приложено электрическое поле  $\mathcal{E}$ , слетают частицы с квазимаквелловским распределением по скоростям, характеризуемым температурой  $T_n > T$ . Экспериментальная величина  $\Delta T = T_n - T$  характеризует превышение эффективной температуры распределения десорбирующихся ионов по начальным скоростям поступательного движения над температурой поверхности. Будем также, как и в [1], считать, что зарядовое состояние слетающих частиц определяется температурой эмиттера  $T$ , а вероятность слета частиц температурой  $T_n$ .

При наличии ускоряющего ионы электрического поля работа десорбции ионов ( $\lambda_+$ ) уменьшится на величину  $\Delta\lambda(\mathcal{E}) = \lambda_+ - \lambda_+^\mathcal{E}$ , где ( $\lambda_+^\mathcal{E}$ ) — работа десорбции ионов в электрическом поле. Наряду с этим в поле  $\mathcal{E}$  на расстоянии от поверхности  $x_k$ , на котором кончается электронный обмен между частицей и поверхностью, уровень отсчета потенциала вакуума изменится на величину  $e\mathcal{E}x_k$  [3]. Соответственно этому сместится электронный уровень нейтральной частицы, что можно представить как увеличение эффективной работы выхода поверхности ( $e\varphi$ ) на ту же величину  $e\mathcal{E}x_k$ .

Тогда величина  $e(V' - \varphi)$ , определяющая вероятность перехода электрона из адчастицы в эмиттер [3], запишется в виде  $e(V' - \varphi - \mathcal{E}x_k)$ . Здесь  $V'$  — потенциал ионизации адсорбированной частицы при  $\mathcal{E} = 0$  на критическом расстоянии ( $x_k$ ) от поверхности. Итак, отношение вероятностей превращения адсорбированной частицы в ион или нейтраль [3] в электрическом поле запишется в виде

$$\frac{w'_+}{w'_0} = A \exp \left[ \frac{e(\varphi - V' + \mathcal{E}x_k)}{kT} \right] \quad (1)$$

где  $A$  — отношение статистических сумм ионного и нейтрального состояний.

Выражение для  $\Delta\lambda$  можно получить при интегрировании разности сил, действующих на ион от критического расстояния  $x_k$  до  $x = \infty$  при  $\mathcal{E} = 0$  и до  $x = x_0$  при  $\mathcal{E} \neq 0$ . Здесь  $x_0$  — такое расстояние, при котором сила внешнего поля  $e\mathcal{E}(x_0)$ , действующая на ион, уравнивается силой зеркального отображения ( $e^2/4x_0^2$ ). В результате интегрирования получим [4]

$$\Delta\lambda = \frac{e^2}{4x_0} + e\mathcal{E}x_0 - e\mathcal{E}x_k.$$

Таким образом, работа удаления иона с поверхности в электрическом поле будет

$$\lambda_+^\mathcal{E} = \lambda_+ - \frac{e^2}{4x_0} - e\mathcal{E}x_0 + e\mathcal{E}x_k. \quad (2)$$

Теперь для выявления связи между работами удаления частиц с поверхности при наличии поля ( $\lambda_+^\mathcal{E}$  и  $\lambda_0^\mathcal{E}$ ) и потенциалами ионизации ( $V$  и  $V'$ ) подставим выражение (2) в уравнение, полученное из кругового термодинамического цикла [5] ( $eV' - eV + \lambda_+ - \lambda_0$ ) = 0, записанного при отсутствии поля

$$eV' + \lambda_+^\mathcal{E} + \frac{e^2}{4x_0} + e\mathcal{E}x_0 - e\mathcal{E}x_k - \lambda_0^\mathcal{E} - eV = 0. \quad (3)$$

Здесь  $\lambda_0^\varepsilon$  — работа удаления нейтральной частицы при  $\mathcal{E} \neq 0$ ,  $V$  — потенциал ионизации частицы. Используя (3) и равенство  $e^2/4x_0 + e\mathcal{E}x_0 = e\sqrt{e\mathcal{E}}$ , перепишем (1) в виде

$$\frac{w'_+}{w'_0} = A \exp \left[ \frac{e(\varphi - V + \sqrt{e\mathcal{E}})}{kT} + \frac{\lambda_+^\varepsilon - \lambda_0^\varepsilon}{kT} \right]. \quad (4)$$

Как уже упоминалось, вероятность электронного перехода определяется температурой подложки, а вероятность удаления частицы с поверхности — локальной температурой самой частицы  $T_H$ . Для максвелловского распределения, соответствующего температуре  $T_H$ , отношение вероятностей того, что кинетическая энергия нейтралей и ионов превышает соответственно значения  $\lambda_+^\varepsilon$  и  $\lambda_0^\varepsilon$ , равно

$$\frac{w\lambda_+^\varepsilon}{w\lambda_0^\varepsilon} = \exp \left[ \frac{\lambda_0^\varepsilon - \lambda_+^\varepsilon}{kT_H} \right].$$

Степень неравновесной поверхностной ионизации в электрическом поле, равная отношению произведения вероятностей, будет

$$\alpha_H = \frac{w'_+ \cdot w_{\lambda_+^\varepsilon}}{w'_0 \cdot w_{\lambda_0^\varepsilon}} = A \exp \left[ \frac{e(\varphi - V + \sqrt{e\mathcal{E}})}{kT} - \frac{\lambda_+^\varepsilon - \lambda_0^\varepsilon}{kT} \left( 1 - \frac{1}{1 + \Delta T/T} \right) \right]. \quad (5)$$

Подставляя в (5) выражение для  $\lambda_+^\varepsilon - \lambda_0^\varepsilon$  из (3) и используя тождество  $V' - V = (V' - \varphi) - (V - \varphi)$ , получим

$$\alpha_H = A \exp \left[ \frac{e(\varphi + \sqrt{e\mathcal{E}} - V)}{kT} \left( 1 - \frac{\Delta T}{T_H} \right) + \frac{e(\varphi + \mathcal{E}x_k - V')}{kT} \cdot \frac{\Delta T}{T_H} \right] \quad (6)$$

или

$$\alpha_H = A \exp \left[ \frac{e(\varphi + \sqrt{e\mathcal{E}} - V)}{kT_H} \right] \left[ 1 + \frac{\varphi + \mathcal{E}x_k - V'}{\varphi + \sqrt{e\mathcal{E}} - V} \cdot \frac{\Delta T}{T} \right]. \quad (6a)$$

При  $\mathcal{E} = 0$  уравнение (6a) должно перейти в выражение для  $\alpha_H$ , полученное в [1]. Однако, поскольку в отличие от данной статьи в [1] использовалось разложение по  $\Delta T/T$ , они

несколько различаются. Приведенные здесь значения  $\alpha_n$  и другие соотношения, использующие его, являются более точными.

Для того чтобы получить выражения для тока ионов, рассмотрим 2 случая.

1. Ионизация трудноионизируемых частиц  $e(V - \varphi - \sqrt{e\mathcal{E}}) \gg kT$ . В этом случае  $\alpha \ll 1$ , поэтому  $j_n \simeq e\nu\alpha_n$ . При этом в выражении (6а) последним слагаемым в квадратных скобках можно пренебречь, поскольку  $(\varphi + \mathcal{E}x_k - V')/(\varphi + \sqrt{e\mathcal{E}} - V) < 1$  [1,3], см. также (3), и  $(\Delta T/T) < 1$ . Тогда

$$j_n \simeq e\nu A \exp \frac{e(\varphi + \sqrt{e\mathcal{E}} - V)}{kT_n},$$

где  $\nu$  — поток частиц на поверхность. Отношение тока неравновесной ионизации к равновесному току

$$\frac{j_n}{j_p} \simeq \exp \left[ \frac{e(\varphi + \sqrt{e\mathcal{E}} - V)}{kT} \left( -\frac{\Delta T}{T_n} \right) \right]$$

показывает, что при колебательном возбуждении адсорбированных трудноионизируемых частиц ионный ток с поверхности увеличивается (знак (-) в круглых скобках меняет знак показателя экспоненты на положительный).

2. Ионизация легкоионизируемых частиц  $V \leq \varphi + \sqrt{e\mathcal{E}}$ . В этом случае ток определяется коэффициентом поверхностной ионизации  $\beta_n$  [3]

$$j_n = e\nu_+ = e\nu\beta_n = \frac{e\nu}{1 + 1/\alpha_n}.$$

Подставляя сюда (6), получим

$$j_n = \frac{e\nu}{1 + (1/A) \exp \left\{ e(V - \varphi - \sqrt{e\mathcal{E}})/kT_n + [e(V' - \varphi - \mathcal{E}x_k)\Delta T]/TT_n k \right\}}. \quad (7)$$

Из (7) видно, что при  $\Delta T \neq 0$  ток  $j_n$  слабо уменьшается относительно равновесного тока при данном поле.

Интересно сравнить величину  $\alpha_n$  с равновесным значением степени поверхностной ( $\alpha_p$ ) ионизации при температуре эмиттера  $T_n$ . Для этого составим отношение  $\alpha_n$  и  $\alpha_p^{T_n}$ , используя (6) и значение

$$\alpha_p^{T_n} = A \exp \left[ \frac{e(\varphi + \sqrt{e\mathcal{E}} - V)}{kT_n} \right],$$

$$\frac{\alpha_n}{\alpha_p^{T_n}} = \exp \frac{e(\varphi + \mathcal{E}x_k - V') \Delta T}{kT_n T}. \quad (8)$$

Из этого соотношения видно, что ток неравновесной поверхностной ионизации может быть как больше равновесного тока при температуре эмиттера  $T_n$  в случае  $V' < \varphi + \mathcal{E}x_k$  и  $V > \varphi + \sqrt{e\mathcal{E}}$ , так и меньше, если  $V' > \varphi + \mathcal{E}x_k$  и  $V > \varphi + \sqrt{e\mathcal{E}}$ .

Интересным и важным оказывается тот факт, что уравнение (8) дает принципиальную возможность определять квантовые характеристики процесса поверхностной ионизации при измерении абсолютных значений плотности ионного тока. При  $\mathcal{E} = 0$  и  $\Delta T \neq 0$  можно определить  $V'$ , а при  $\mathcal{E} \neq 0$  и  $\Delta T \neq 0$  можно измерить  $x_k$ .

Авторы приносят искреннюю благодарность Н.Д. Потехиной за полезные обсуждения.

### Список литературы

- [1] Блащенко Н.М., Лаврентьев Г.Я. // Письма в ЖЭТФ. 1988. Т. 14. с. 1359–1363. В. 115.
- [2] Блащенко Н.М., Лаврентьев Г.Я. // ЖТФ. 1990. Т. 60. В. 2. С. 154–158.
- [3] Зандберг Э.Я., Ионов Н.И. Поверхностная ионизация. М.: Наука, 1969. 432 с.
- [4] Блащенко Н.М., Лаврентьев Г.Я. // ЖТФ. 1991. Т. 61. В. 1. С. 155–160.
- [5] Добрецов Л.Н., Гомоюнова М.В. Эмиссионная электроника. М.: Наука, 1966. 564 с.

Физико-технический институт  
им. А.Ф. Иоффе РАН  
С.-Петербург

Поступило в Редакцию  
5 сентября 1995 г.